

# Benutzerdefiniertes PTFE-Wafer-Handlingsgestell

## Korrosionsbeständig Hochtemperaturfest Halterung Für Polysilizium-Halbleiterverarbeitung

Artikelnummer: PL-CP287



### Einführung

Hochwertige, maßgefertigte PTFE-Wafer-Halterungen, die für extreme chemische Umgebungen und die Hochtemperatur-Halbleiterverarbeitung entwickelt wurden. Diese korrosionsbeständigen Träger gewährleisten eine hochreine Handhabung, reibungsarme Operationen und außergewöhnliche Haltbarkeit für kritische Polysilizium-, Photovoltaik- und Fertigungsabläufe in der fortschrittlichen Elektronik.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Silizium-Wafer-Ätzen	Sicheres Halten von Siliziumwafern während des Eintauchens in aggressive Flusssäure- und Salpetersäuregemische.	Außergewöhnliche Säurebeständigkeit und null Verunreinigungen.
RCA-Reinigungsprozess	Verwendung als Träger in mehrstufigen Reinigungssequenzen unter Verwendung von Ammoniak und Wasserstoffperoxid.	Widersteht der Degradation durch starke Oxidationsmittel.
Solarzellenproduktion	Unterstützung von photovoltaischen Substraten während Dotierungs- und Oberflächentexturierungsprozessen in der Solarindustrie.	Hohe thermische Stabilität und chemische Trägheit.
Polysilizium-Ingot-Handhabung	Verwaltung der Platzierung von hochreinen Polysiliziumstücken während der Reinigung und Analyse.	Verhindert das Auswaschen von Metallionen und Oberflächenkontaktschäden.
Spurenanalyse-Laborgeräte	Dient als spezialisiertes Gestell für die Lagerung und den Transport von hochreinen Proben in der analytischen Chemie.	Sichert das höchste Niveau an Probenintegrität und Reinheit.
Halbleiter-Nassbank	Integration in automatisierte Nassprozesssysteme für die Reinigung und Spülung von Substraten in großen Mengen.	Niedrige Reibung erleichtert eine reibungslose automatische Handhabung.
Galvanische Vorrichtungen	Fungiert als nicht leitende, chemisch beständige Unterstützung während präziser Elektroabscheidungsprozesse.	Elektrische Isolierung kombiniert mit chemischer Stabilität.

Parameter	Spezifikationsdetail
Produktidentifikation	PL-CP287
Basismaterial	Hochreines Polytetrafluorethylen (PTFE)
Herstellungsprozess	Präzisions-CNC-Bearbeitung / Benutzerdefinierte Fertigung
Verfügbarkeit der Anpassung	Vollständig nach Benutzerspezifikationen angefertigt
Temperaturbereich	-200 °C bis +260 °C
Chemische Verträglichkeit	Universell (Inert gegenüber den meisten Säuren, Basen und Lösungsmitteln)
Oberflächenfinish	Hohe Glätte, nicht haftend, hydrophob

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Parameter	Spezifikationsdetail	
Schlitzkonfiguration	Anpassbare Breite, Tiefe und Teilung	
Tragfähigkeit	Angepasst an Substratdichte und -menge	
Verunreinigungskontrolle	Metallfreie, zusatzstofffreie Konstruktion	
Abmessungen	Benutzerdefiniert entwickelt nach Kundenanforderung	